

1. 特定有害業務 → 行なっている場合は、業務内容を記入してください。

- イ. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ. 異常気圧下における業務
- ヘ. さく岩機、鋳打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ト. 重量物の取扱い等重激な業務
- チ. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ. 坑内における業務
- ヌ. 深夜業を含む業務
- ル. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

2. 特定化学物質等 → 使用している薬品Noを記入してください。

- | | |
|---|--|
| 1. ベンジジン及びその塩 | 40. ジクロロメタン（二塩化メチレン） |
| 2. 四－アミノジフェニル及びその塩 | 41. ジメチル－ニ・ニージクロロピニルホスフェイト（DDVP） |
| 3. 四－ニトロジフェニル及びその塩 | 42. 一・一・ジメチルヒドラジン |
| 4. ビス（クロロメチル）エーテル | 43. 臭化メチル |
| 5. ペーターナフチルアミン及びその塩 | 44. 重クロム酸及びその塩 |
| 6. ジクロルベンジン及びその塩 | 45. 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。） |
| 7. アルファ－ナフチルアミン及びその塩 | 46. スチレン |
| 8. 塩素化ビフェニル（PCB） | 47. 一・一・ニ・ニートトラクロロエタン（四塩化アセチレン） |
| 9. オルト－トリジン及びその塩 | 48. テトラクロロエチレン（パークロルエチレン） |
| 10. ジアニシジン及びその塩 | 49. トリクロロエチレン |
| 11. ベリリウム及びその化合物 | 50. トリレンジイソシアネート |
| 12. ベンゾトリクロリド | 51. ナフタレン |
| 13. アクリルアミド | 52. ニッケル化合物
（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。） |
| 14. アクリロニトリル | 53. ニッケルカルボニル |
| 15. アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基で有る物に限る。） | 54. ニトログリコール |
| 16. インジウム化合物 | 55. パラ－ジメチルアミノアゾベンゼン |
| 17. エチルベンゼン | 56. パラ－ニトロクロルベンゼン |
| 18. エチレンイミン | 57. 砒素又はその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。） |
| 19. エチレンオキシド | 58. 弗化水素 |
| 20. 塩化ビニル | 59. ペタープロピオラクトン |
| 21. 塩素 | 60. ベンゼン |
| 22. オーラミン | 61. ペンタクロルフェノール（PCP）及びそのナトリウム塩 |
| 23. オルト－フタロジニトリル | 62. ホルムアルデヒド |
| 24. カドミウム及びその化合物 | 63. マゼンタ |
| 25. クロム酸及びその塩 | 64. マンガン及びその化合物 |
| 26. クロロホルム | 65. メチルイソブチルケトン |
| 27. クロロメチルメチルエーテル | 66. 沃化メチル |
| 28. 五酸化バナジウム | 67. リフラクトリーセラミックファイバー |
| 29. コバルト又はその無機化合物 | 68. 硫化水素 |
| 30. コールタール | 69. 硫酸ジメチル |
| 31. 酸化プロピレン | 70. オルト－トルイジン |
| 32. シアン化カリウム | 71. 三酸化ニアンチモン |
| 33. シアン化水素 | 72. 溶接ヒューム |
| 34. シアン化ナトリウム | |
| 35. 四塩化炭素 | |
| 36. 一・四－ジオキサン | |
| 37. 一・ニージクロロエタン（二塩化エチレン） | |
| 38. 三・ミージクロロ－四・四－ジアミノジフェニルメタン | |
| 39. 一・ニージクロロブタン | |

※1～11, 13～29, 31, 33, 35～55, 57, 59～61, 63～72についてはその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む

※12についてはその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。

※30, 32, 34, 56, 58についてはその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。

3. 鉛及び四アルキル鉛 → 使用している場合は、業務内容を記入してください。

1. 鉛、その合金及び化合物（四アルキル鉛を除く）
2. 四アルキル鉛

4. 有機溶剤 → 使用している薬品No, 業務内容Noを記入してください。

(薬品)

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. アセトン | 25. シクロヘキサノン |
| 2. イソブチルアルコール | 26. 削除 |
| 3. イソプロピルアルコール | 27. 削除 |
| 4. イソペンチルアルコール（イソアミルアルコール） | 28. 一・ニージクロルエチレン（二塩化アセチレン） |
| 5. エチルエーテル | 29. 削除 |
| 6. エチレングリコールモノエチルエーテル
（セロソルブ） | 30. N・N-ジメチルホルムアミド |
| 7. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
（セロソルブアセテート） | 31. 削除 |
| 8. エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル
（ブチルセロソルブ） | 32. 削除 |
| 9. エチレングリコールモノメチルエーテル
（メチルセロソルブ） | 33. 削除 |
| 10. オルトージクロルベンゼン | 34. テトラヒドロフラン |
| 11. キシレン | 35. 一・一・一トリクロルエタン |
| 12. クレゾール | 36. 削除 |
| 13. クロルベンゼン | 37. トルエン |
| 14. 削除 | 38. 二硫化炭素 |
| 15. 酢酸イソブチル | 39. ノルマルヘキサノール |
| 16. 酢酸イソプロピル | 40. 一・一・一トリクロルエタン |
| 17. 酢酸イソペンチル（酢酸イソアミル） | 41. 二・一・一トリクロルエタン |
| 18. 酢酸エチル | 42. メタノール |
| 19. 酢酸ノルマルブチル | 43. 削除 |
| 20. 酢酸ノルマルプロピル | 44. メチルエチルケトン |
| 21. 酢酸ノルマルペンチル（酢酸ノルマルアミル） | 45. メチルシクロヘキサノール |
| 22. 酢酸メチル | 46. メチルシクロヘキサノン |
| 23. 削除 | 47. メチルノルマルブチルケトン |
| 24. シクロヘキサノール | |

※上記に掲げる有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤をその混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含める。

(業務内容)

- イ. 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
- ロ. 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
- ハ. 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- ニ. 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
- ホ. 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- ヘ. 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- ト. 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- チ. 有機溶剤等を用いて行う洗浄（ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。）又は払しょくの業務
- リ. 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務（ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。）
- 又. 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
- ル. 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
- ヲ. 有機溶剤等を入れたことのあるタンク（有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。）の内部における業務

5. 電離放射線 → エックス線装置を使用する業務に従事するもの

6. 粉じん作業 → 常時粉じん作業に従事する労働者（過去に常時粉じん作業に従事したが、現在は非粉じん作業に従事する労働者も含みます）